

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma

Couches minces par pulvérisation cathodique

AC 450



by

allianceconcept

Flexible et simple d'utilisation, l'AC450 vous garantit le succès dans vos recherches.

Machine de développement par excellence, notre bâti **AC450 présente une diversité de configurations** qui vous permettra de vous équiper avec le système dont vous avez besoin.

Votre choix portera sur :

- Configuration sputter up ou down
- Sas d'introduction
- Configuration planar (4 x 100 mm par exemple) ou convergente (3 x 100 mm)
- Porte-substrat refroidi et/ou chauffant (jusqu'à 800°C)
- Alimentations de puissance RF, DC, DC+ pour les cathodes
- Polarisation RF du porte-substrat pour les phases d'activation de surface avant dépôt et/ou dépôt en mode bias
- Pompage primaire sec ou à palettes
- Pompage secondaire turbomoléculaire ou cryogénique
- Asservissement de pression
- Etc.



Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Diamètre enceinte : | 450 mm |
| Hauteur : | 305 mm |
| Volume : | 50 litres |
| Vide limite (configuration turbo) : | 5.10^{-7} mbar ^[1] |
| Vide limite (configuration cryogénique) : | 5.10^{-8} mbar ^[1] |
| Capacité machine : | 4 positions actives 100 mm |
| Uniformité planar : | < +/- 5% ^[1] |
| Uniformité convergent : | < +/- 3% ^[1] |
| Possibilité sas : | Oui |
| Pilotage machine automatique : | - Gestion des procédés - Traçabilité |

^[1] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

